

51. 수면하 수중의 주위 유동장 및 쇄파의 실험적 해석에 관한 연구

조선공학과 최경신
지도교수 현범수

수중익선과 같은 고속선의 경우 수중익이 수면근처에 접근하면 여러 형태의 파를 유기하게 되며 그에 의한 압력의 변화를 유발시킨다. 이에 따라 양력이 감소하고 조파저항이 증가하다가 한계 Froude 수에 이르게 되면 파가 더 이상 자신의 형태를 유지하지 못하고 부서지는 쇄파가 발생하면서 조파저항은 감소하고 그대신 쇄파저항이 급격히 증가하게 된다.

이에 대한 연구의 한 방법으로 수면하에서 정속으로 움직이는 수중익에 의하여 생성되는 정상파 및 쇄파현상에 대한 연구를 회류수조에서 수행하였다. 수중익의 몰수깊이와 속도에 따른 자유표면의 형상, 물체 후류에서의 전수두 손실, 속도분포 그리고 PIV를 이용한 속도분포 및 와도분포 계측을 하였고 그들간의 상관성을 조사하였다. 파형은 충분히 깊은 몰수심에서부터 점점 얇아질수록 정상파의 발생 → 파장은 일정하나 파고는 증가하는 형태의 정상파 증폭 → 쇄파의 초기 발생 → 쇄파의 증가와 정상파의 감소 → 쇄파의 증가로 이어지는 변환과정을 살펴보았으며, 쇄파의 발생은 파경사각이 대략 14° 에서 발생함을 알아내었다. 물수체 후류에서 수두손실을 계측한 결과 쇄파가 발생한 영역에서부터 급격한 수두손실 분포가 수표면에서 얻어졌으며, 이로부터 수두손실의 계측이 쇄파연구에 매우 효과적인 방법임을 알 수 있었다.

쇄파 주위 와류유동의 자세한 구조는 PIV를 이용한 순간 속도장의 계측으로부터 얻을 수 있었다. 쇄파발생지점 이후와 수중익 뒤에서의 와도분포는 수중익에서 떨어져 나온 Vortex와 쇄파로부터 기인한 Vortex에 의해서 잘 증명되었다. 또한 AOM (Acoustic Optic Modulator)을 사용하여 수중익 주위 경계층 및 반류, 큰 받음각에서의 유동박리현상을 보다 자세히 계측할 수 있었으며 쇄파 발생영역에서 쇄파가 발생하여 후류로 진행하는 현상 또한 자세히 해석할 수 있었다.

52. Design and Implementation of an Intranet-based Message and File Transfer System via INMARSAT-C

전자통신공학과 강병훈
지도교수 임재홍

This paper describes the design and implementation of an intranet-based message and file transfer system using the INMARSAT-C for easy transmission and user-friendly interface. For these, onboard LAN including telex, printer and database with centralized one server is designed

and constructed. Also, onboard computing environment which provides the INMARSAT-C terminal and RS-232C link interface built in with effective intranet-based web mail system between the ship and land.

53. MELTBACK 방법을 이용한 평면 매립형 레이저 다이오드 제작에 관한 연구

전자통신공학과 김정호
지도교수 홍창희

초고속 광통신의 광원으로 사용되는 고성능 광소자의 전형적인 구조인 매립형(Buried Heterostructure ; BH)-LD의 경우 다중양자우물(Multiple Quantum Well ; MQW) DH 웨이퍼는 MOVPE로 성장하여 재성장에는 LPE를 사용하는 경우를 지나 모든 공정을 MOVPE로 LD를 제작하고 있는 실정이다. 그리고 국내의 경우 BH-LD 구조의 하나인 평면 매립형(Planar Buried Heterostructure ; PBH)-LD의 경우 선진국과 비슷한 수준의 연구를 수행하고 있으며, 1996년 이후 PBH-LD는 모든 공정을 MOVPE를 사용하여 제작하고 있는 실정이다. 그리고 대량생산 및 재현성 측면에서 MOVPE나 MBE의 경우가 LPE에 비해 월등히 우수하며 그 사용정도는 더욱 가속화되고 사용 폭이 넓어질 것으로 보인다. 본 논문에서는 본 연구실에서 직접 제작하여 운용 중인 수직형 LPE 장치를 이용하여 10여 년간 쌓아온 기초 연구결과를 바탕으로 최근에 광 가입자망 등에 사용되고 있는 고성능 광소자인 PBH-LD를 meltback 방법을 이용하여 제작하였다.

meltback 용액과 온도에 따른 meltback 특성을 조사한 결과, 610°C에서 80%의 포화 용액을 사용하는 것이 적당한 것으로 확인하였다. 메사 모양을 형성하기 위해 화학에칭과 meltback 방법을 이용하였다. 에피 웨이퍼의 p-InP층을 H₃PO₄+HCl(4:1)용액으로 1분간 에칭한 후 활성층을 H₂SO₄+H₂O₂+H₂O (1:1:5)용액으로 3분 20초간 에칭하였고, n-InP층을 H₃PO₄+HCl(4:1)로 2분 20초간 에칭한 다음 80%의 불포화용액을 이용하여 610°C에서 10초간 meltback을 하고 난 후 전류 차단층을 성장하였다. 3차 재성장을 위해 Si₃N₄ 마스크를 6:1 BOE(Buffered Oxide Etchant)로 제거한 후, 열손상 방지용으로 성장된 p+-InGaAs층을 제거하였다. 그리고 p-InP와 p+-InGaAs층을 성장시켰다. 웨이퍼의 p측 전극으로 Ti(300Å)/Pt(200Å)/Au(4000Å)을 E-beam 증착기로 증착하였다. 이렇게 증착된 전극은 RTA(Rapid Thermal Annealing)장치에서 425°C로 30초간 열처리하였다. 다음으로 LD의 공진기 거울면을 형성하는데 용이하도록 웨이퍼의 두께를 75μm 되게 뒷면을 lapping하였다. n측 전극은 Cr(500Å)/Au(5000Å)을 E-beam 증착기를 사용하여 증착시켰으며, 400°C에서 30초간 열처리를 하였다. 제작된 PBH-LD의 순방향 임계전압이 0.8V이고, 역방향 항복전압은 5.8V정도 되었고 직렬저항은 5Ω정도이었다. I_{th}는 공진기 길이가 300μm일 때 10mA로서 일반적인 PBH-LD들과 유사한 값으로 나타났다. 내부양자효율 η_i = 82%로서 캐리어의 주입효율이 우수하며, 활성층의 특성이 우수한 것으로 추정할 수 있다. 그리고 내부손실은 9.2cm⁻¹로서 일반적인 PBH-LD의 내부손실과 비슷하다는 것을 알 수 있다. 특성 온도 T₀는 20°C에서 45°C까지는 65K로 나타났으며, 45°C에서 65°C 사이에서는 42K인 것으로 나